

Title (en)

NEW SOLUBLE AND/OR MELTABLE POLYAMIDE-POLYAMIDE, POLYAMIDE-POLYAMIDEIMIDE AND POLYAMIDE-POLYIMIDE BLOCK COPOLYMERS.

Title (de)

NEUE LÖSLICHE UND/ODER SCHMELZBARE POLYAMID-POLYAMID-, POLYAMID-POLYAMIDIMID- UND POLYAMID-POLYIMID-BLOCKCOPOLYMERE.

Title (fr)

NOUVEAUX COPOLYMERES BLOC POLYAMIDE-POLYAMIDE, POLYAMIDE-POLYAMIDEIMIDE ET POLYAMIDE-POLYIMIDE SOLUBLES ET/OU FUSIBLES.

Publication

EP 0386088 A1 19900912 (DE)

Application

EP 88910006 A 19881110

Priority

DE 3738458 A 19871112

Abstract (en)

[origin: EP0315993A1] Soluble and/or meltable polyamide-polyamide (PA-PA1), polyamide-polyamideimide (PA-PAI) or polyamide-polyimide (PA-PI) block copolymers of general formula (I) in which n is a whole number from 1 to 200, x is a whole number from 1 to 20, R1 is a divalent aromatic residue, R is the residue of general formula (II) and a) in the case of the PA-PA1 block copolymers, X is the residue -NH-, Y is the residue -NH-CO-, where in each case N is bonded to R and B is a residue of general formula (III), where y is a whole number from 1 to 20, R2 is a divalent aromatic residue and R3 is a divalent aromatic residue different from R, b) in the case of the PA-PAI block copolymers, either: X is the residue = N-, Y is the residue -NH- and B is the residue of general formula (IV), where Ar is a trivalent aromatic residue, or: X and Y are the residue = N- and B is the residue of general formula (V), where Y is a whole number from 0 to 20 and R3 is R or a divalent aromatic residue and Ar is as defined above, c) in the case of the PA-PI block copolymers, X and Y are the residue = N- and B is the residue of general formula (VI), where y is a whole number from 0 to 20 and R3 is R or a divalent aromatic residue and Ar is a tetravalent aromatic residue. Also described is a process for their manufacture.

Abstract (fr)

Copolymères bloc polyamide-polyamide (PA-PA1), polyamide-polyamideimide (PA-PAI) ou polyamide-polyimide (PA-PI) de formule générale (I) dans laquelle n est un entier valant de 1 à 200, x est un entier valant de 1 à 20, R1 est un résidu aromatique bivalent, R représente le résidu de formule générale (II), ainsi que a) dans le cas des copolymères bloc PA-PA1, X représente le résidu -NH-, Y le résidu -NH-CO-, N étant respectivement lié à R, et B représente un résidu de formule générale (III), où y est un entier valant de 1 à 20, R2 est un résidu aromatique bivalent et R3 est un résidu aromatique bivalent différent de R; b) dans le cas des copolymères bloc PA-PAI, soit X est le résidu = N-, Y le résidu -NH- et B le résidu de formule générale (IV), où Ar représente un résidu aromatique trivalent, soit X et Y représentent le résidu = N- et B le résidu de formule générale (V), où y représente un entier valant de 0 à 20 et R3 représente R ou un résidu aromatique bivalent, et Ar à la notation précitée; c) dans le cas des copolymères bloc PA-PI, X et Y représentent le résidu = N- et B le résidu de formule générale (VI), où y est un entier valant de 0 à 20 et R3 représente R ou un résidu aromatique bivalent, et Ar un résidu aromatique tétravalent. Est également décrit un procédé pour leur fabrication.

IPC 1-7

C08G 69/32; C08G 73/14; C08G 81/00

IPC 8 full level

C08G 69/32 (2006.01); C08G 69/42 (2006.01); C08G 73/10 (2006.01); C08G 73/14 (2006.01); C08G 81/00 (2006.01)

CPC (source: EP)

C08G 69/32 (2013.01); C08G 73/14 (2013.01); C08G 81/00 (2013.01)

Citation (search report)

See references of WO 8904337A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0315993 A1 19890517; EP 0315993 B1 19920401; AT E74369 T1 19920415; DE 3738458 A1 19890524; DE 3869738 D1 19920507;
EP 0386088 A1 19900912; ES 2031983 T3 19930101; GR 3004242 T3 19930331; JP H03500786 A 19910221; WO 8904337 A1 19890518

DOCDB simple family (application)

EP 88118752 A 19881110; AT 88118752 T 19881110; DE 3738458 A 19871112; DE 3869738 T 19881110; EP 8801020 W 19881110;
EP 88910006 A 19881110; ES 88118752 T 19881110; GR 910401674 T 19920402; JP 50921488 A 19881110